

TiN FORM

ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK

Lurrunketa teknologia	PVD Sputtering/Arkua
Estalduraren materiala	TiN
Estalduraren lodiera	3-6 µm
Kolorea	Urre
Gogortasuna	2500HV
Deposizio tenperatura	200°C / 450-480°C
Lan. tenperatura max.	500°C

Micro eta Duplex gama eskuragarri

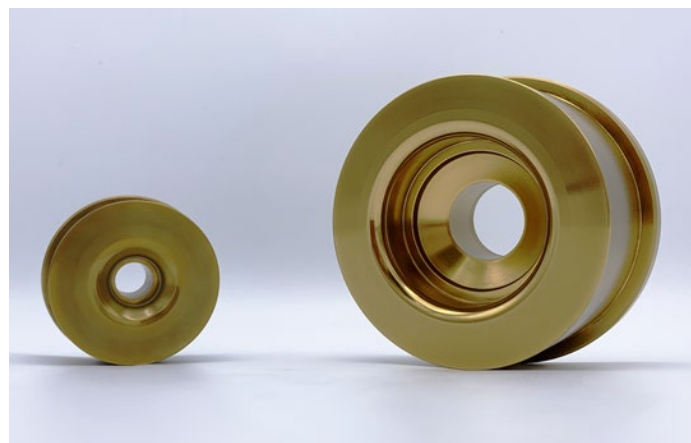


Gainestalduraren ezaugarriak

- Higaduraren aurkako moldakortasuna Gogortasun altua.
- Zimurtasun baxua.
- Marruskadura-koefiziente baxua.

Erabilera industrialak

Bere moldakortasuna eta ospea direla medio TiN Form ebaketa-erreminta, punzoi, tolestzaile, injekziomolde eta higaduraren menpe dauden piezetan erabiltzen da.



 **FLUBETECH**
SURFACE ENGINEERING

RG-TCTF1